

研究タイトル:

## 微細回路に対応するエッチング技術の開発



氏名:	松本克才 / MATSUMOTO Katsutoshi	E-mail:	kmatsu-c@hachinohe-ct.ac.jp
職名:	教授	学位:	博士(工学)
所属学会・協会:	表面技術協会、エレクトロニクス実装学会、日本金属学会、日本鉄鋼協会、 資源素材学会、化学工学会		
キーワード:	エッチング、溶解、浸出、移動現象論、反応速度論、微細回路形成法		
技術相談 提供可能技術:	<ul style="list-style-type: none"> <li>・金属材料の溶解挙動</li> <li>・回路用銅箔のウェットエッチング</li> <li>・固-液系不均一反応速度論</li> </ul>		

### 研究内容:

近年の電子機器の小型化・高集積化に伴う超高集積化技術を実現するために必要不可欠であるプリント配線板などの微細回路作製に対応したウェットエッチング技術開発を目的として研究している。

### 電子機器の小型化



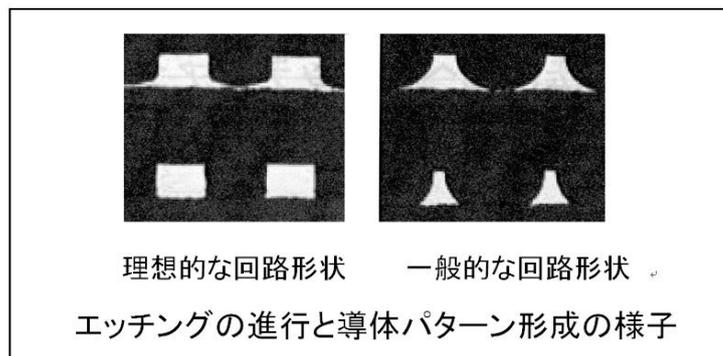
マルチメディア、インターネット、モバイル

$$\text{電子機器の価値} = \frac{\text{電子機器の性能}}{\text{サイズ} \times \text{コスト} \times \text{消費電力}}$$

小型化・高性能化に対する要求は無増



銅箔回路の微細化により、対応可能



### 提供可能な設備・機器:

名称・型番(メーカー)	
形状測定レーザーマイクロスコープ	VK-X100/X110 (キーエンス)